

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
7. Juli 2005 (07.07.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/061132 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **B08B 7/00,**  
C23C 16/44, B01D 24/00, H01L 21/3213

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/000250

(22) Internationales Anmeldedatum:  
15. Januar 2004 (15.01.2004)

(25) Elnreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
103 58 275.4 11. Dezember 2003 (11.12.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Aus-  
nahme von US): **WIESSNER GMBH** [DE/DE];  
Dr.-Hans-Frisch-Strasse 4, 95448 Bayreuth (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **HEPPER, Ronald**

[DE/DE]; Warmuthsreut 29, 95511 Mistelbach (DE).  
**KALLEE, Klaus** [DE/DE]; Bahnhofstrasse 7, 06188  
Landsberg (DE).

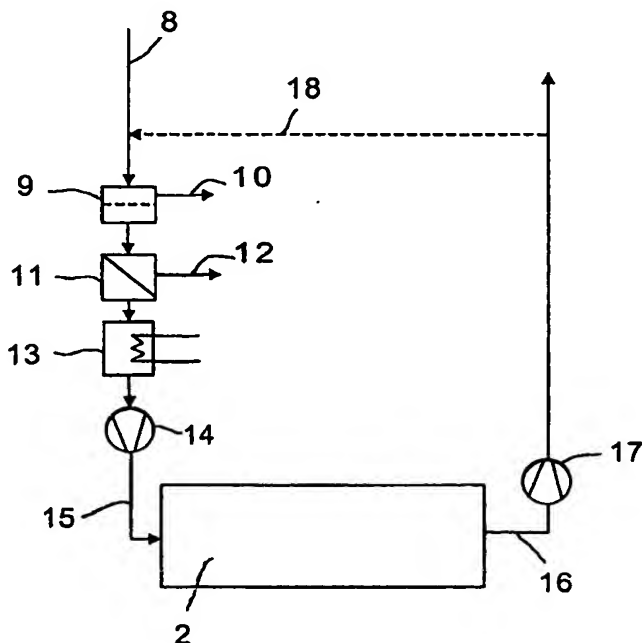
(74) Anwalt: **SCHRÖER, Gernot, H.**; Meissner, Bolte & Part-  
ner, Bankgasse 3, 90402 Nürnberg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,  
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,  
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,  
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,  
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,  
ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR CLEANING AT LEAST ONE PROCESS CHAMBER USED FOR COATING AT  
LEAST ONE SUBSTRATE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM REINIGEN WENIGSTENS EINER PROZESSKAMMER ZUM  
BESCHICHTEN WENIGSTENS EINES SUBSTRATS



(57) Abstract: The invention relates to a method  
and device for cleaning at least one process cham-  
ber (7) that is used for coating at least one substrate  
(3), especially a glass substrate. According to the  
invention, the at least one process chamber (7) is  
flushed with a conditioned bleed gas (15) prior to  
a coating process.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung  
betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung  
zum Reinigen wenigstens einer Prozesskammer  
(7) zum Beschichten wenigstens eines  
Substrats (3), insbesondere aus Glas, wobei die  
wenigstens eine Prozesskammer (7) vor einem  
Beschichtungsvorgang mit einem konditionierten  
Spülgas (15) gespült wird.

WO 2005/061132 A1